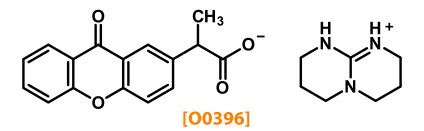




# 用于阴离子紫外光固化的



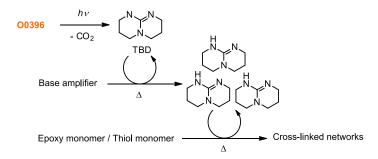
• 高效的光致脱羧反应

(量子产率: φ=ca. 0.64), 在紫外光照射(254 nm or 365 nm)下释放出游离的TBD

• TBD通过使用O0396和可以释放TBD的碱基放大剂可以成倍的增加。

## 应用

使用由环氧单体与硫醇单体制备的反应性树脂进行阴离子紫外光固化



Without base amplifier

: a reactive resin cures through 365 nm light irradiation by addition of 10 mol% O0396 for monomer.
: a reactive resin cures through 365 nm light irradiation by addition of 3 mol% O0396 and 6 mol% base amplifier for monomer. With base amplifier

K. Arimitsu, Yuki Gosei Kagaku Kyokaishi (J. Syn. Org. Chem., Jpn.) 2012, 70, 508; K. Arimitsu, Tokyo University of Science, Jpn. Kokai Tokkyo Koho 2011 236416, 2011;

K. Arimitsu, Tokyo University of Science, Jpn. Kokai Tokkyo Koho 2012 237776, 2012.

# 2-(9-Oxoxanthen-2-yl)propionic Acid 1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene Salt

此产品在Koji Arimitsu教授的指导下进行商品化。

1g [00396]

#### 无碱基结构产品

# 2-(9-Oxoxanthen-2-yl)propionic Acid

1g [**O0395**]

### 其它光产碱剂

Acetophenone O-Benzoyloxime 2-Nitrobenzyl Cyclohexylcarbamate 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl Cyclohexylcarbamate 1g / 5g [A2502]

1g [N1052] 200mg / 1g [B5085]

更多信息,请查看我们的主页: www.TCIchemicals.com ▶▶▶ 引发剂





# 梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 www.TCIchemicals.com

询价与订购联系方式:

电话: 800-988-0390/021-6712-1386

传真: 021-6712-1385 邮件: Sales-CN@TCIchemicals.com

地址:上海化学工业区普工路96号 邮编:201507